

●有機電子デバイス作製装置

本装置は、有機蒸着室、金属蒸着室、ロードロック室で構成された真空成膜装置が1列に配列されており、背面に循環装置への搬送容器、グローブボックス付き不活性ガス循環装置が接続されています。各成膜室・搬送容器間にはゲートバルブが設置されており、大気に曝すことなく、基板を搬送可能な有機電子デバイス作成装置です。



※誠南工業では数多くの実績を基に御客様のご要望に合わせて、設計・製作を行っております。

※本装置構成は九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センター（OPERA） 安達研究室へ納品した装置を基に製作しております。

※よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含み下さい。

装置構成

・有機蒸着室 ・金属蒸着室	チャンバー：550(W)×600(H)×550(D)程度【mm】 材質：SUS304 / 表面処理：G.B.B 処理 基板回転機構：Z 軸方向 S=80 蒸着源：通電加熱式蒸着源【有機蒸着室：8 式・金属蒸着室：4 式】 (制御装置にて遠隔制御可能)・シールド付き蒸着ボード・蒸着源用シャッター付き 蒸着電源：6V・130A デジタル表示 正面扉：角型ハッチ式扉【O リング仕様(水冷機構付き)・手動シャッター付のぞき窓】 排気系：ターボポンプ 400L/s・ロータリーポンプ：250L/m / メインバルブ・粗挽きバルブ・排気バルブ・リークバルブ / 真空度：5.0×10^{-5}Pa 程度 付属品：膜厚計 2 台 / 膜厚モニタ / 真空計($4 \times 10^{-8} \sim 1 \times 10^5$Pa 程度・大気圧確認用) / 予備ポート【有機蒸着室 3 箇所・金属蒸着室 4 箇所】
ロードロック室	チャンバー：250(W)×450(H)×250(D)程度【mm】 材質：SUS304 / 表面処理：G.B.B 処理 カセット：基板ホルダーが 3 式収納可能、Z 軸方 S=100 上下駆動可能 正面扉：φ203ICF クイックアクセスドア(窓付き) 排気系：ターボポンプ 70L/s・ロータリーポンプ：90L/m / メインバルブ・粗挽きバルブ・排気バルブ・リークバルブ / 真空度：9.0×10^{-4}Pa 程度 付属品：真空計($5 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^5$Pa 程度・大気圧確認用)
その他	基板ホルダー：□100mm 基板サイズ：□15、□25、□40 等 基板搬送：トランスファーロードにて成膜室を搬送可能 安全操作のインターロック機構付き / キャスター付き架台 ベーキング温度：150℃ グローブボックス付き不活性ガス循環装置 搬送室チャンバー：およそ 360(W)×400(H)×360(D)程度【mm】 材質：SUS304 / 表面処理：G.B.B 処理 タッチパネルによる各種成膜室の独立した真空排気及び大気解放操作可能



※よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含み下さい。